

06.1; 06.2

© 1992

ГЕТЕРОПЕРЕХОДЫ ИЗ *InSe*, СФОРМИРОВАННЫЕ
ТЕРМИЧЕСКИМ ОКИСЛЕНИЕМ
КРИСТАЛЛИЧЕСКОЙ ПОДЛОЖКИ

В.Н. К а т е р и н ч у к, М.З. К о в а л ю к

Полупроводниковое соединение *InSe* используется для изготавления многих, преимущественно фотодиодных, структур: барьеров Шоттки [1], гетеропереходов [2], МДП-приборов [3], р-п-гомопереходов [4, 5] и других. По ширине запрещенной зоны в 1.2 эВ [6] оно принадлежит к числу полупроводников, применение которых наиболее целесообразно в преобразователях солнечной энергии. Однако выводы перечисленных работ свидетельствуют также о возможности использования *InSe* в качестве основы при создании высокочувствительных фотоприемников.

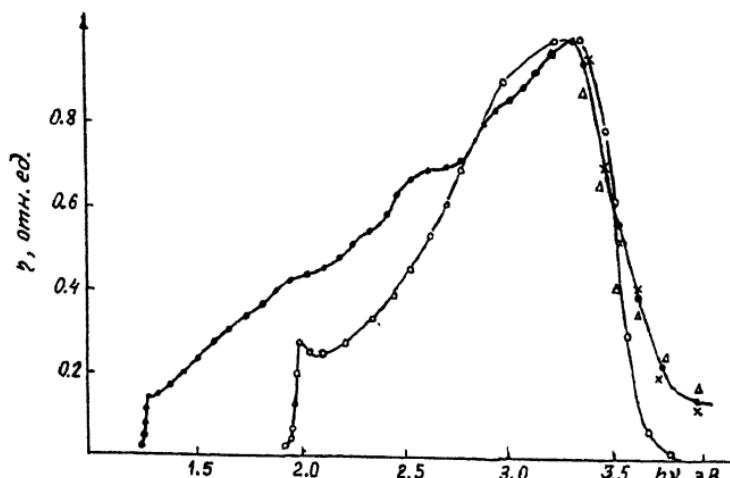
В данной работе с целью упрощения технологии и (или) улучшения некоторых фотоэлектрических параметров гетеропереходов, создаваемых на основе *InSe*, предложен способ изготовления р-п-перехода путем формирования собственной окисной проводящей пленки на поверхности кристаллической подложки из этого материала.

Для исследований использовались образцы моноселенида индия р-типа проводимости, выращенные методом Бриджмена, с концентрацией дырок $\sim 10^{13}$ см⁻³ и их подвижностью $\sim 10^2$ см²/В с. Поскольку *InSe* принадлежит к группе слоистых кристаллов, то получение из него подложек состояло в расщеплении слитка на плоскопараллельные пластины требуемой толщины без каких-либо обработок поверхности.

Термическое окисление подложек *InSe* проводилось на воздухе при температурах соответственно 300, 350 и 400 °C в электропечи, управляемой блоком стабилизации температуры. Для сравнительного анализа полученных результатов продолжительность процесса окисления во всех опытах составляла 10 минут. После обрезания торцов и удаления окисной пленки на одной из сторон подложки создавались омические контакты.

Результаты измерения поверхностного сопротивления ρ_s , полученных пленок на *InSe*, представлены в таблице. Из этих типичных данных следует, что в результате окисления образуется проводящая пленка, сопротивление которой снижается по мере увеличения температуры процесса.

На рисунке представлены также спектры фотоответа диодных структур собственная проводящая пленка - *InSe* при различных



Спектры квантовой эффективности гетероструктур собственный оксисел-р-*InSe* (черные кружки) и *In₂O₃-GaSe* (светлые кружки) при комнатной температуре. Точки x, Δ и ▲ на коротковолновом крае соответствуют фотоответу исследуемых структур при 300, 350 и 400 °C режимах окисления.

$t_{\text{окис.}}, \text{ }^{\circ}\text{C}$	300	350	400
$R_s, \Omega/\square$	11000	830	437

режимах их формирования и для сравнения спектр фотоответа гетероперехода *In₂O₃-GaSe*. Слой *In₂O₃* наносился путем пульверизацией спиртового раствора хлорида индия на нагретые подложки из *GaSe* [7]. Хорошее совпадение коротковолнового края этих спектров (расхождение кривых не превышает используемой разрешающей способности монохроматора в 13 Å) позволяет сделать предположение об образовании на подложках из *InSe* триоксида индия при всех исследуемых температурах.

Полученные таким образом гетеропереходы проводящий окисел-*InSe* обладают значительной фоточувствительностью. Абсолютное значение монохроматической ампер-ваттной чувствительности лучших образцов составляет для длины волны света $\lambda=0.35$ мкм (в максимуме квантовой эффективности) ~ 0.2 А/Вт. Простота изготовления, особенность спектральной характеристики с возрастающей фоточувствительностью при уменьшении длины волны и близкая к теоретической токовая чувствительность делают исследуемые гетеропереходы предпочтительными среди аналогичного класса фотоприемников.

Список литературы

- 1] Giulio M.D., Micoscossi G., Rizzo A., Teroge A. // J. Appl. Phys. 1983. Т. 54. № 10. Р. 5839-5843.
- 2] Бакуменко В.Л., Ковалюк З.Д., Курбатов Л.Н., Таагаев В.Г., Чишко В.Ф. // ФТП. 1978. Т. 12. № 2. С. 374-377.
- 3] Курбатов Л.Н., Балыченко А.А., Бакуменко В.Л., Морозов В.А., Чишко В.Ф., Махиджанов С.С. // Письма в ЖТФ. 1978. Т. 4. № 18. С. 1110-1113.
- 4] Shigetomi S., Ikari T., Koga Y., Shigetomi S. // Jap. J. Appl. Phys. 1988. Т. 27. № 7. Р. 1271-1274.
- 5] Катеринчук В.Н., Ковалюк М.З. // ФТП. 1991. Т. 25. № 5. С. 954-957.
- 6] Гавриленко В.И., Грехов А.М., Корбутяк Д.В., Литовченко В.Г. Оптические свойства полупроводников. Справочник. Киев: Наукова думка, 1987. 608 с.
- 7] Dawar A.L., Joshi J.C. // J. Mater. Sci. 1984. Т. 19. № 1. Р. 1-23.

Поступило в Редакцию
15 мая 1992 г.